

機器利用技術講習会のご案内

【超薄膜評価システム】 分光エリプソメータ

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年8月27日(水) 15:45~17:00

*当日、「半導体デバイス製造用スパッタ装置(10:15~14:00)」および「触針式膜厚測定装置(14:15~15:30)」の機器利用技術講習会も行っております。当講習会では、これらの機器利用技術講習会で作製した薄膜試料を測定し、取得したデータを用いて解析を行います。装置の理解をより深めるためにも「半導体デバイス製造用スパッタ装置」および「触針式膜厚測定装置」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所(和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：3名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。

※ 受講には TRI カードが必要です。まだお持ちでない方は当日お申し込みいただけます(無料)。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。

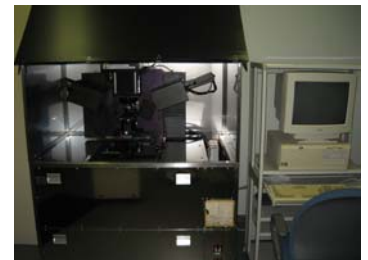
メールでお申し込みを頂いた方のみ、返信にて受付をお知らせします。

なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：超薄膜評価システム(分光エリプソメータ)

超薄膜評価システム(分光エリプソメータ)は、試料の光学定数(屈折率、消衰係数)や薄膜の膜厚を非破壊で簡便に測定できる装置です。エリプソメトリーとは、偏光を用いた測定技術です。一般に光を物質に照射した場合、入射光と反射光では、偏光状態が異なります。入射光と反射光の偏光状態の変化には、物質の情報が含まれています。この変化を解析することにより、光学定数や薄膜の膜厚を得ることが出来ます。

本講習では、初めて分光エリプソメータを使用する方を対象に、装置の簡単な解説を行った後に、実際に本講習用に準備した薄膜試料を測定していただきます。このことにより、分光エリプソメトリー測定技術の理解を深めることを目的とします。



機器型番：FTM-7700W
大塚電子株式会社

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 佐藤 和郎、山田 義春、笈 芳治

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

